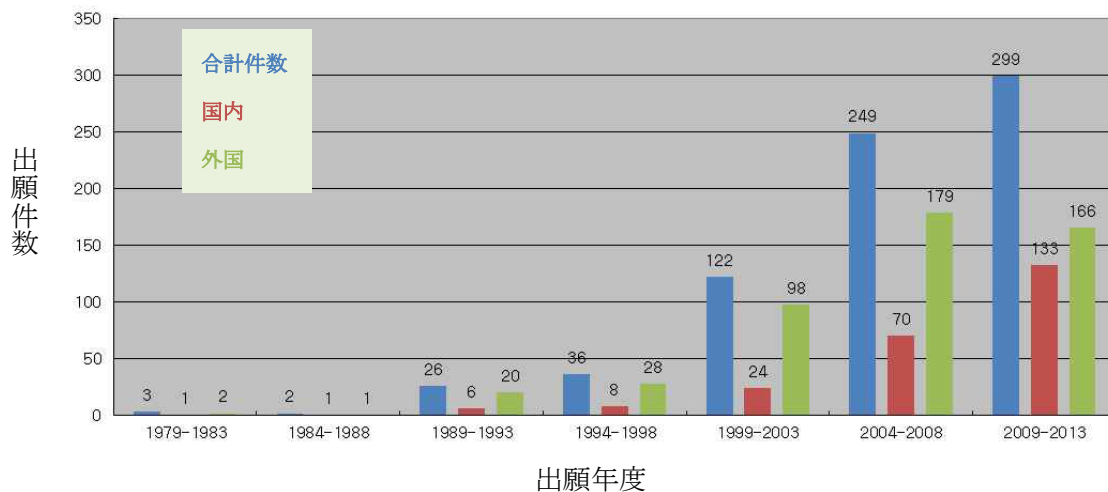
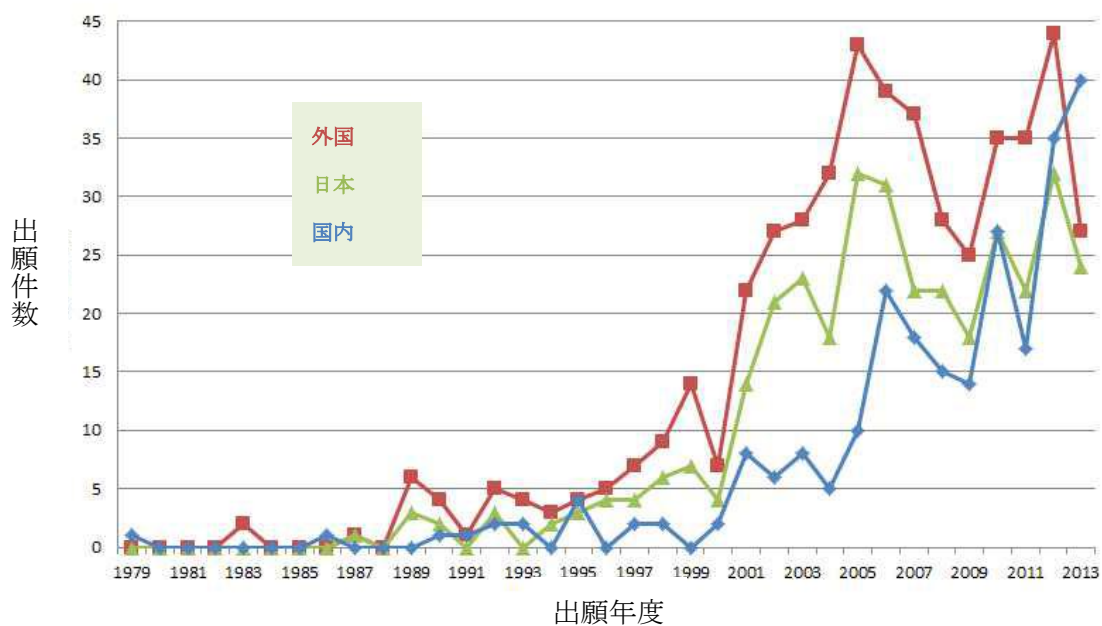


[別添 1] 光学表面処理技術に関する国内特許の出願動向(1979～2013)

※関連の国際特許分類(IPC) : G02B1/10、G02B1/11、G02B1/12

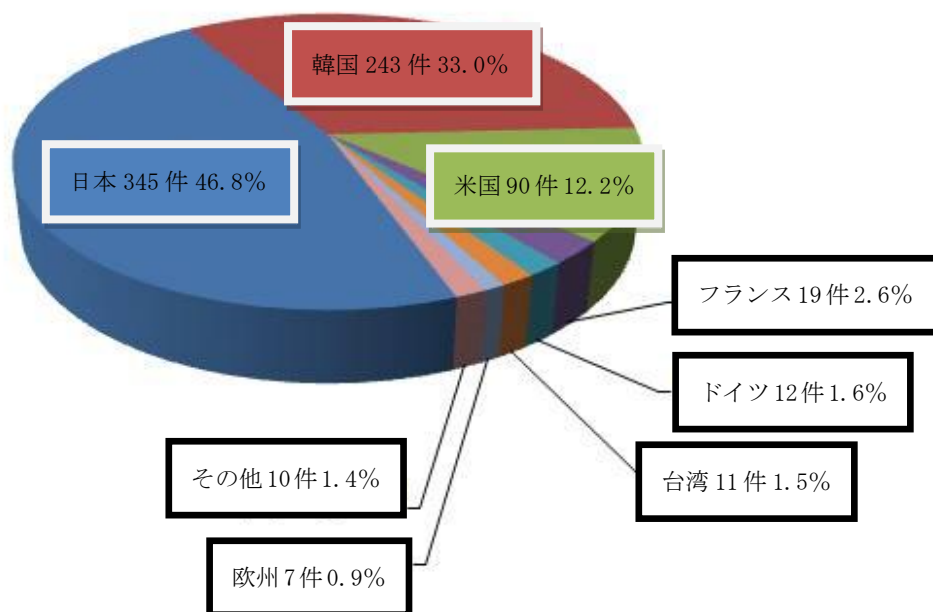


(a) 出願年度区間別の特許出願動向



(b) 出願年度別の特許出願動向

[別添 2] 光学表面処理技術に関する国内・外国人の国内特許出願動向 (1979～2013)



[別添 3] 光学表面処理技術に関する出願人別動向 (1979～2013)

出願人	国籍	出願件数
大日本印刷株式会社	日本	59
3M Innovative Properties Company	米国	25
ソニー株式会社	日本	22
ホヤ株式会社	日本	21
フジ写真フィルム株式会社	日本	17
東友ファインケム株式会社	韓国	17
フジフィルム株式会社	日本	17
日東電工株式会社	日本	16
株式会社 LG 化学	韓国	15
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D` OPTIQUE))	フランス	14
株式会社巴川製紙所	日本	12
東レ先端素材株式会社	韓国	10
セイコーエプソン株式会社	日本	10
サムスン電機株式会社	韓国	9
サムスン電子株式会社	韓国	9
Minnesota Mining & Manufacturing Company	米国	9
旭硝子株式会社	日本	8
光州科学技術院	韓国	8
リンテック株式会社	日本	8
JSR 株式会社	日本	7
第一毛織株式会社	韓国	7
INNOVATION & INFINITY GLOBAL CORPORATION	台湾	6
Eastman Kodak Company	米国	6
東海オプティカル株式会社	日本	6
凸版印刷株式会社	日本	6
韓国機械研究院	韓国	6
韓国科学技術研究院	韓国	6
株式会社ブリヂストン	日本	6
住友化学株式会社	日本	6
株式会社コーロン	韓国	5
コニカミノルタオプトインコーポレーテッド	日本	5
株式会社暁星	韓国	5
MERCK PATENT GMBH	ドイツ	5

LG イノテック株式会社	韓国	5
株式会社ニコン	日本	5
韓国科学技術院	韓国	5